



Photomask Japan 2019

第26回 ホトマスク技術展示会

The 26th TECHNICAL EXHIBITION



www.photomask-japan.org

展示会招待券
INVITATION

主催：ホトマスクジャパン(PMJ) / SPIE
共催：BACUS / EMLC
協賛：SEMI ジャパン

Organized by : Photomask Japan / SPIE
Co-organized by : BACUS / EMLC
Sponsored by : SEMI Japan

パシフィコ横浜 アネックスホール
2019年 4月17日(水) 10:00 - 18:00
18日(木) 10:00 - 17:00

Annex Hall, Pacifico Yokohama
April 17(Wed.) 10:00 - 18:00
18(Thu.) 10:00 - 17:00

Invitation by courtesy of:

主な出展製品

- ホトマスク
- マスク部材
- レジスト
- EUVL関連
- 製造装置
- 検査装置
- 修正装置
- 試験/測定装置
- 洗浄装置
- CADデータ処理
- シミュレーション
- 出版・サービス

研究・開発、設計、技術、生産・製造、経営・管理に携わる専門家、
購買・調達ご担当者に最新技術を提供します。

TECHNICAL EXHIBITION provides the latest technologies to all people in research & development, design, engineering, production & manufacturing, general management, and purchasing & procurement in mask industry.

MAIN EXHIBITS

- Photomask
- Material
- Resist
- EUVL
- Manufacturing
- Inspection
- Repair
- Metrology/Testing
- Cleaning
- CAD Data Process
- Simulation
- Publication/Service

出展社 (五十音順)

(株)アストロン
(株)アドバンテスト
アプライドマテリアルズ
稲畑産業(株)
(株)インターソフト
(株)エイチ・ティー・エル
エイビーム・テクノロジーズ・ジャパン(株)
(株)エス・イー・アール
MSP Corporation
カールツァイス(株)
キャノンマーケティングジャパン(株)
サイバー옵ティクスコーポレーション
シグマメルテック(株)
芝浦メカトロニクス(株)
(株)ダン・タクマ

TOOL(株)
(株)ナノシステムソリューションズ
日本コントロールシステム(株)
日本シノプシス(同)
日本電子(株)
(株)ニューフレアテクノロジー
ハイデルベルグ・インストルメンツ(株)
ヒューグルエレクトロニクス(株)
(株)堀場製作所
(株)ホロン
マイクロニックテクノロジーズ(株)
松下精機(株)
レーザーテック(株)
列真(株)

2019年2月6日現在

EXHIBITORS (in alphabetical order)

aBeam Technologies Japan, Inc.
ADVANTEST CORPORATION
Applied Materials, Inc.
ASTRON Inc.
Canon Marketing Japan Inc.
Carl Zeiss Co., Ltd.
CyberOptics Corporation
Dan Takuma Technologies Inc.
Heidelberg Instruments, KK
HOLON CO., LTD.
HORIBA, Ltd.
HTL Co. Japan Ltd.
Hugle Electronics Inc.
Inabata & Co., Ltd.
Intersoft Co., Ltd.

JEOL Ltd.
Lasertec Corporation
LAZIN CO., LTD.
MATSUSHITA SEIKI CO., LTD.
MSP Corporation
Mycronic Technologies Corporation
NanoSystem Solutions, Inc.
Nihon Synopsys G.K.
Nippon Control System Corporation
NuFlare Technology, Inc.
S.E.R. Corporation
Shibaura Mechatronics Corporation
SIGMAMELTEC LTD.
TOOL CORPORATION

As of February 6, 2019

お問合せ： Photomask Japan 事務局 (株) JTBコミュニケーションデザイン内
Photomask Japan Secretariat c/o JTB Communication Design, Inc.
TEL: 03-5657-0777 FAX: 03-3452-8550 E-mail: pmj-exh@jtbcom.co.jp www.photomask-japan.org

展示会来場登録用紙 / REGISTRATION FORM for Exhibition

名刺を添えて受付にお持ちください。
Provide complete information and present it at the registration counter with your business card.

業種 ① Industry Field

- 半導体設計 Device design
- 電気・電子機器製造 Electronics
- マスク製造 Mask Fabrication
- 半導体・マスク製造装置 Fabrication equipment
- 半導体およびマスク材料・部品製造 Materials
- 検査・修正 Inspection / Repair
- 半導体およびマスク設計ツール機器 CAD design
- 商社および販売代理店 Trading Company / Agent
- 研究・教育機関 Universities / Research Organizations
- その他 Others

職種 ② Job Category

- 経営者・会社役員 Corporate / General manager
- 研究・開発 Research & development
- 生産・製造 Production / Manufacturing
- 設計 Design
- 技術 Engineering Support
- 営業・マーケティング Sales / Marketing
- 品質管理 Quality Control / Quality Assurance
- 購買・資材部門 Purchasing / Procurement
- 検査 Testing / Inspection
- 教職員・学生 University Professors / Students
- 報道記者 Press
- その他 Others

来場の目的 ③ Purpose of Visit

- 一般の情報収集 Collect information
- 製品購入のための情報収集 Meet suppliers
- 製品購入 Place orders
- 販売代理店/技術提携企業の募集 Find representative / joint ventures
- その他 Others

次回の展示について ④ Participation in the next exhibition

- 出展を予定する Would like to exhibit
- 出展の検討をしたい Would like to consider exhibiting
- 来場を予定する Would like to visit

ご登録いただいた個人情報に今後Photomask Japanからの情報を送付させていただく場合がございます。希望しない場合は以下のチェックボックスにチェックしてください。
 希望しない

COMPLETE OR ATTACH BUSINESS CARD 名刺を貼付又は記入してください

NAME
氏名 _____

COMPANY/ORGANIZATION
勤務先 _____

DEPT/JOB TITLE
所属部署・役職名 _____

COMPANY ADDRESS
会社所在地 _____

PHONE: _____ FAX: _____

E-MAIL: _____

4月16日(火) - 18日(木)
パシフィコ横浜(アネックスホール)

主催: ホトマスクジャパン(PMJ) / SPIE
共催: BACUS / EMLC
後援: 横浜市 /
応用物理学会 / 精密工学会 / 電気学会

参加費: 60,000円
早期割引: 4/2(火)までに登録の場合は55,000円
※4/16(火)FPDセッション13:20~14:30のみ参加の場合12,000円
(早期割引10,000円)

April 16(Tue.)- 18(Thu.)
Annex Hall of Pacifico Yokohama

Organized by: Photomask Japan / SPIE
Co-organized by: BACUS / EMLC
Supported by: City of Yokohama /
JSAP / JSPE / IEEEJ

Registration Fee: ¥60,000
Pre-registration by April 2: ¥55,000
*FPD Session April 16, 13:20- 14:30 only: ¥12,000
(Early-bird: ¥10,000)

Registration -> www.photomask-japan.org

お問合せ: Photomask Japan 事務局
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング
(株)JTBCコミュニケーションデザイン内
TEL: 03-5657-0777 FAX: 03-3452-8550
pmj@jtbcom.co.jp

Inquiries: Photomask Japan Secretariat
c/o JTB Communication Design, Inc.
Celestine Shiba Mitsui Bldg. 3-23-1 Shiba, Minato-ku,
Tokyo 105-8335, JAPAN
TEL: +81-3-5657-0777 FAX: +81-3-3452-8550
pmj@jtbcom.co.jp

Symposium Program

The program is based on commitments received by the time of publication and is subject to change without notice.

As of February 6, 2019

Table with 3 columns: April 16 (Tue.), April 17 (Wed.), April 18 (Thu.). Rows show session times and topics like Opening, Session 1-14, Lunch Break, Break, and Banquet.

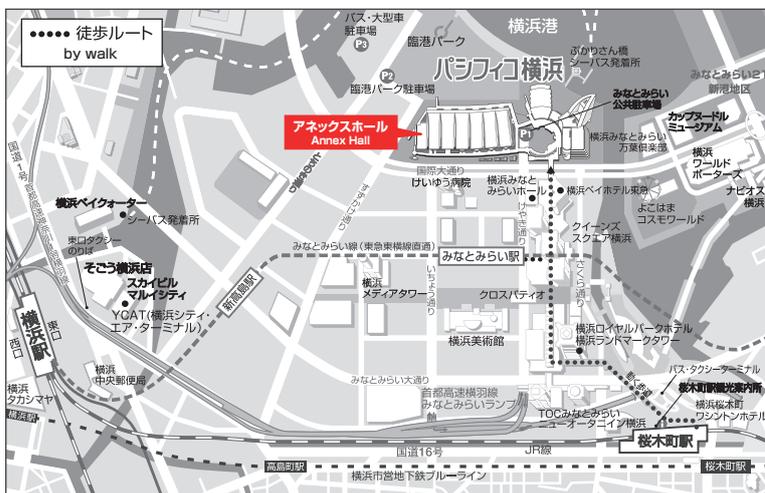
Technical Exhibition

Please refer to the reverse side.

April 17(Wed.) 10:00 - 18:00

April 18(Thu.) 10:00- 17:00

ACCESS



パシフィコ横浜
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1
TEL: 045-221-2155
URL: http://www.pacifico.co.jp

PACIFICO YOKOHAMA
1-1-1 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama,
Kanagawa, 220-0012, Japan
TEL: +81-45-221-2155

- 徒歩: みなとみらい駅(東急東横線直通みなとみらい線)
タクシー: 横浜駅から約10分
バス: 桜木町駅前4番のりばから市営バスにて約11分
電車: 東京方面から横浜駅まで約30分~40分
新幹線: 新横浜駅からJR横浜線で菊名駅へ
飛行機: 羽田空港からリムジンバスでインターコンチネンタルホテルまで約40分